



# *Physique des Matériaux II*

---

*Filière : SMP - Semestre : VI*

*Travaux Dirigés  
Série n°2*

*2024/2025*

## Problème n°1

On considère la fonction  $f_{FD}(E)$  comme étant la fonction de distribution des électrons dans un semi conducteur ;

---

1. Rappeler l'expression de cette fonction de distribution ;
2. En déduire l'expression de la fonction de distribution des trous ;
3. Dans l'approximation de la statistique de Maxwell Boltzmann donner les fonctions équivalentes aux distributions des électrons et des trous ;
4. On considère le semi-conducteur non dégénéré ; établir les expressions des concentrations des porteurs de charge.

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha} \cdot e^{-x} \cdot dx = \alpha \sqrt{\pi}$$

### 1. Expression de la fonction de distribution des électrons $f_n$

$$f_n(E) = f_{FD}(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1}$$

---

### 2. Expression de la fonction de distribution des trous $f_p$

$$f_p(E) = 1 - f_{FD}(E) = 1 - \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1}$$

$$f_p(E) = \frac{1}{e^{\frac{E_F-E}{k_B T}} + 1}$$

### 3. Approximation de M.B

La distribution statistique de Fermi-Dirac peut être simplifiée de la façon suivante

$$f_D(E) \approx e^{-\frac{E-E_F}{k_B T}} = f_{MB}(E)$$

$$f_n(E) \approx e^{-\frac{E-E_F}{k_B T}}$$

$$f_p(E) \approx e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}$$

#### 4. Expressions des concentrations des porteurs de charge dans un semiconducteur non dégénéré

**Concentrations des électrons**

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{E - E_C} \cdot e^{-\frac{E - E_F}{k_B T}} dE$$

---

On pose

$$x = \beta(E - E_C) \quad dx = \beta dE$$

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{e^{-\beta(E_C - E_F)}}{\beta^{3/2}} \int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$$

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} x^\alpha \cdot e^{-x} \cdot dx = \alpha \sqrt{\pi}$$

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e \cdot k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-\beta(E_C - E_F)} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$n = 2 \left( \frac{2\pi m_e \cdot k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-\beta(E_C - E_F)}$$

## Concentrations des trous

$$p = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_t}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{E_V} \sqrt{E_V - E} \cdot e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} dE$$

---

On pose

$$y = \beta(E_V - E) \quad dy = -\beta dE$$

$$p = -\frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_t}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{1}{\beta^{3/2}} \int_{+\infty}^0 \sqrt{y} \cdot e^{-y} \cdot e^{\beta(E_V - E_F)} dE$$

$$p = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_t k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\beta(E_V - E_F)} \int_0^{+\infty} \sqrt{x} \cdot e^{-x} dx$$

$$p = 2 \left( \frac{2\pi m_t \cdot k_B T}{h^2} \right)^{3/2} e^{\beta(E_V - E_F)}$$

## Concentrations intrinsèque

$$n = p = n_i \qquad n_i^2 = n \cdot p$$

---

$$n_i^2 = 4 \left( \frac{2\pi \cdot k_B T}{h^2} \right)^3 (m_e \cdot m_t)^{3/2} \cdot e^{-\beta(E_C - E_V)}$$

$$n_i = 2 \left( \frac{2\pi \cdot k_B T}{h^2} \right)^{3/2} (m_e \cdot m_t)^{3/4} \cdot e^{-\beta \frac{E_g}{2}}$$

## Problème n°2

Soit un cristal semi-conducteur intrinsèque (Ge) à  $T = 300\text{K}$  ;

1. Déterminer la position du niveau de Fermi intrinsèque d'un tel cristal ;
2. Calculer la concentration intrinsèque ;
3. Combien d'atomes de Ge donnent naissance à une paire électron/trou ?

On donne :

$$M_{\text{Ge}} = 72,59\text{g}$$

$$\rho = 5,33\text{g/cm}^3 \quad E_g = 0,66\text{eV}$$

$$m_e = m_t = 0,5m_0$$

---

### 1. Position du niveau de Fermi intrinsèque du cristal de Ge

Il s'agit d'un SC intrinsèque :

$$E_{F_i} = \frac{E_C + E_V}{2}$$

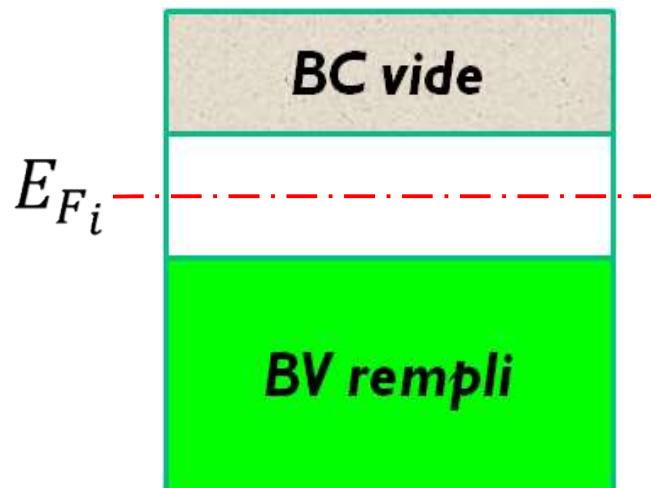
$$E_C = E_g + E_V$$

$$E_{F_i} = E_V + \frac{E_g}{2}$$

**ou**

$$E_V = E_C - E_g$$

$$E_{F_i} = E_C - \frac{E_g}{2}$$



## 2. Concentration intrinsèque

$$n_i = 2 \left( \frac{2\pi \cdot k_B T}{h^2} \right)^{3/2} (m_e \cdot m_t)^{3/4} \cdot e^{-\beta \frac{E_g}{2}}$$

$$k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} \text{ j/K}$$

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg / s}$$

---

$$n_i = 2,53 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

## 3. Création de paire électrons/trous

La concentration intrinsèque donne le nombre d'électrons ou de trous par unité de volume

$$n = p = n_i$$

La concentration atomique du germanium est donnée par l'expression suivante :

$$n_a = \frac{\rho \cdot N_{av}}{M} \quad n_a = 4,42 \cdot 10^{22} \text{ cm}^3$$

Soit  $N_0$  le nombre d'atomes ionisés du Ge

(Atomes ionisés : atomes qui donnent naissance à une paire électrons/trous)

$$N_0 = n_i \cdot V \quad N_{at} = n_{at} \cdot V$$

$$\frac{N_0}{N_{at}} = \frac{n_i}{n_{at}} = 6 \cdot 10^{-10}$$



## Problème n°3

On considère un semi-conducteur intrinsèque dont les concentrations équivalentes d'états énergétiques dans les bandes de valence et de conduction sont notées  $n_V$  et  $n_C$ .

---

1. Rappeler les expressions des concentrations des porteurs de charges ( $n$  et  $p$ ) ;
2. En déduire l'expression de la concentration intrinsèque  $n_i$  ainsi que la position du niveau de Fermi  $E_{Fi}$  ;
3. Le semi-conducteur en question est du silicium ; calculer la concentration intrinsèque et la position du niveau de Fermi aux différentes températures : 27°C, 127°C, 227°C.

$$E_g = 1,1 \text{ eV}$$

$$n_C = 2,7 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_V = 1,1 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

1. Concentrations des porteurs de charges (**n** et **p**)

$$n = \underbrace{2 \left( \frac{m_e k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}}_{n_C} e^{\frac{E_F - E_C}{k_B T}} \quad p = \underbrace{2 \left( \frac{m_t k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}}_{n_V} e^{\frac{E_V - E_F}{k_B T}}$$

2. Concentration intrinsèque **n<sub>i</sub>**

$$n = p = n_i \quad n_i^2 = n \cdot p$$

$$n_i^2 = n_C \cdot n_V \cdot e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}} \quad n_i^2 = n_C \cdot n_V \cdot e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

$$n_i = \sqrt{n_C n_V} \cdot e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

Position du niveau de Fermi **E<sub>Fi</sub>**

$$n = p \quad \frac{n}{p} = 1 \quad \frac{n_C}{n_V} e^{\frac{E_{Fi} - E_C}{k_B T}} \cdot e^{\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = 1 \quad \frac{n_C}{n_V} e^{\frac{2E_{Fi} - E_C - E_V}{k_B T}} = 1$$

$$E_{Fi} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln \left( \frac{n_V}{n_C} \right)$$

3. Concentration intrinsèque et position du niveau de Fermi aux différentes températures : 27°C, 127°C, 227°C : cas du Si

$$n_i = \sqrt{n_C n_V} \cdot e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

$$E_{F_i} = \frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln \left( \frac{n_V}{n_C} \right)$$

$$\sqrt{n_C n_V} = 1,723 \cdot 10^{19}$$

$$\frac{n_V}{n_C} = 0,407$$

$$\frac{1}{2} \ln \left( \frac{n_V}{n_C} \right) = -0,449$$

T(K)	300	400	500
$k_B \cdot T$ (eV)	0,026	0,0345	0,043
$n_i$	$1,12 \cdot 10^{10}$	$2,05 \cdot 10^{12}$	$4,8 \cdot 10^{13}$
$E_{F_i}$	0,538	0,534	0,53

## Problème n°4

On considère trois semi-conducteur dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous :

---

	$E_g$ (eV)	$n_c$ (at/cm <sup>3</sup> )	$n_v$ (at/cm <sup>3</sup> )
<b>AsGa</b>	1,43	$4,7 \cdot 10^{17}$	$7 \cdot 10^{18}$
<b>Ge</b>	0,66	$1,04 \cdot 10^{19}$	$6 \cdot 10^{18}$
<b>Si</b>	1,1	$2,7 \cdot 10^{19}$	$1,10 \cdot 10^{19}$

1. Parmi ces trois matériaux, quel est celui qui présente la concentration intrinsèque la plus faible ?
2. Calculer cette concentration intrinsèque pour le matériau choisi à  $T = 300\text{K}$ .

1. Plus faible concentration intrinsèque  $n_i$

$$n_i = \sqrt{n_C n_V} \cdot e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

La concentration intrinsèque  $n_i$  est proportionnelle à  $\sqrt{n_C \cdot n_V}$

	$n_C n_V$	$\sqrt{n_C n_V}$
<b>AsGa</b>	$3,29 \cdot 10^{36}$	$1,8 \cdot 10^{18}$
<b>Ge</b>	$6,24 \cdot 10^{37}$	$7,9 \cdot 10^{18}$
<b>Si</b>	$2,97 \cdot 10^{38}$	$16,3 \cdot 10^{18}$

Il s'agit de l'AsGa

2. Concentration intrinsèque  $n_i$  (AsGa)

	$n_C n_V$	$\sqrt{n_C n_V}$	$e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$	$n_i(\text{cm}^{-3})$
<b>AsGa</b>	$3,29 \cdot 10^{36}$	$1,8 \cdot 10^{18}$	$9,98 \cdot 10^{-13}$	$1,8 \cdot 10^6$

## Problème n°5

Dans un matériau semi-conducteur la concentration intrinsèque est donnée par la relation

---

$$n_i = A. \exp\left(-\frac{\Delta E}{2k_B T}\right)$$

1. Que représente la constante  $\Delta E$  ?
2. Calculer la valeur de A pour les matériaux **Ge** et **Si** ;
3. En déduire les valeurs des concentrations intrinsèques correspondantes à  $T=300K$  ;
4. Quelles sont les fractions d'atomes ionisés dans chaque cas.

On donne :

$$M_{Si}=28g$$

$$\rho=2,33g/cm^3$$

## Constante $\Delta E$

$$n_i = A. \exp\left(-\frac{\Delta E}{2k_B T}\right) \qquad n_i = \sqrt{n_C n_V}. e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

La constante  $\Delta E$  représente le Gap du matériau

Valeurs de A et concentrations intrinsèques pour les matériaux **Ge** et **Si**

	$\sqrt{n_C n_V}$	$\exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$	$n_i(\text{cm}^{-3})$
<b>Ge</b>	$7,899.10^{18}$	$2,89.10^{-6}$	$2,284.10^{13}$
<b>Si</b>	$1,723.10^{19}$	$5,869.10^{-10}$	$1,011.10^{10}$

Fractions d'atomes ionisés dans chaque cas

	$n_a (\text{at/cm}^3)$	$n_i(\text{cm}^{-3})$	$n_i / N_a$
<b>Ge</b>	$4,42.10^{22}$	$2,284.10^{13}$	$5.10^{-10}$
<b>Si</b>	$5,009.10^{22}$	$1,011.10^{10}$	$2.10^{-13}$

## Problème n°6

On considère un barreau de silicium de longueur  $L=5 \text{ mm}$  et de section  $S=1 \text{ mm}^2$ , fortement dopé par du phosphore dont la concentration est  $N_d = 2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ .

---

1. Quelle est la nature du dopage de ce semi conducteur ?
2. Calculer la concentration en trous et électrons ;
3. Calculer la résistivité. Comparer cette valeur à celle du métal cuivre ;
4. Calculer la valeur du courant qui circule dans ce barreau lorsque l'on applique une d.d.p de 5V à ses extrémités.

On donne :

Silicium :  $\mu_n = 1,5 \cdot 10^3 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$      $\mu_p = 5,3 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$      $n_i = 1,1 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$

Cuivre :  $n = 11 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$      $\mu_e = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 / \text{Vs}$



# 1. Nature du dopage du semi conducteur ?

Il s'agit d'un barreau de silicium fortement dopé par du phosphore.

Le phosphore est un élément de la Vème colonne dans le tableau périodique.

---

Dopage par un élément de type V

IVa		Va	
6	C	7	N
14	Si	15	P
32	Ge	33	As
50	Sn	51	Sb
82	Pb	83	Bi

Introduction d'une concentration  $N_d$   
d'atomes donneurs

Le dopage est du type N

## 2. Concentration en trous et électrons

Loi d'action de masse

$$n \cdot p = n_i^2$$

Il s'agit d'un dopage N

Neutralité électrique

$$n + N_a = p + N_d$$

$$N_a = 0$$

$$n - N_d = p$$

$$n \cdot (n - N_d) = n_i^2$$

$$n^2 - n \cdot N_d - n_i^2 = 0$$

---

$$n = \frac{1}{2} \left\{ (N_d - N_a) + \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2} \right\} \quad p = -\frac{1}{2} \left\{ (N_d - N_a) - \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2} \right\}$$

$$n = \frac{N_d}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2}} \right\}$$

$$p = \frac{N_d}{2} \left\{ 1 - \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2}} \right\}$$

$$N_d \gg n_i$$

$$n \approx N_d$$

$$p \approx \frac{n_i^2}{N_d}$$

Application numérique

$$n \approx 2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$p \approx 0,55 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$n \gg p$$

### 3. Résistivité du Si et Comparaison le métal cuivre

**Si**

$$\sigma = ne\mu_{\bar{e}} + pe\mu_t$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$\rho = \frac{1}{n.e.\mu_{\bar{e}} + p.e.\mu_t}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\approx 0}$

$$\rho = \frac{1}{n.e.\mu_{\bar{e}}}$$

$$\rho = 0,21 \Omega m$$

**Cu**

$$\rho = 1,78 \cdot 10^{-8} \Omega m$$

$$\rho_{Cu} \ll \rho_{Si}$$

### 4. Valeur du courant qui circule dans le barreau

Résistance du barreau

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad R = 1,05 K\Omega$$

$$I = \frac{U}{R} \quad I = 4,78 mA$$

